

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2017年8月10日(10.08.2017)



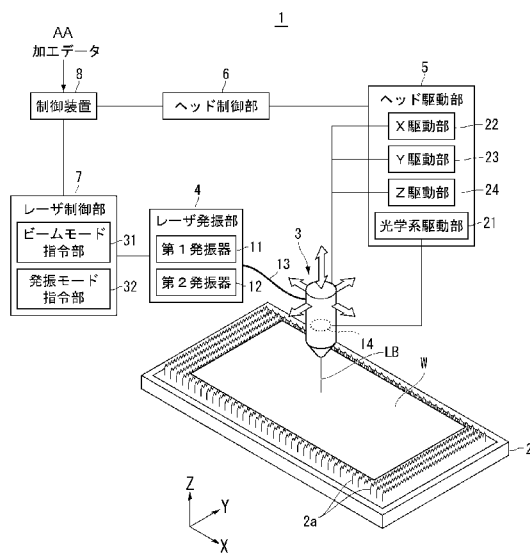
(10) 国際公開番号
WO 2017/134964 A1

- (51) 国際特許分類:
B23K 26/382 (2014.01) **B23K 26/08** (2014.01)
B23K 26/00 (2014.01) **B23K 26/38** (2014.01)
B23K 26/064 (2014.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2016/088688
- (22) 国際出願日: 2016年12月26日(26.12.2016)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2016-020458 2016年2月5日(05.02.2016) JP
- (71) 出願人: 村田機械株式会社(MURATA MACHINERY, LTD.) [JP/JP]; 〒6018326 京都府京都市南区吉祥院南落合町3番地 Kyoto (JP).
- (72) 発明者: 松本 圭太(MATSUMOTO, Keita); 〒4848502 愛知県犬山市大字橋爪字中島2番地村田機械株式会社犬山事業所内 Aichi (JP).
- (74) 代理人: 西 和哉, 外(NISHI, Kazuya et al.); 〒1700013 東京都豊島区東池袋3-9-7 東池袋織本ビル6F Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,

[続葉有]

(54) Title: LASER PROCESSING MACHINE AND LASER PROCESSING METHOD

(54) 発明の名称: レーザ加工機およびレーザ加工方法



- 4 Laser oscillating unit
5 Head driving unit
6 Head control unit
7 Laser control unit
8 Control device
11 First oscillator
12 Second oscillator
21 Optical system driving unit
22 X driving unit
23 Y driving unit
24 Z driving unit
31 Beam mode commanding unit
32 Oscillation mode commanding unit
AA Processed data

(57) Abstract: [Problem] To suppress the generation of processing defects in cutting with a laser beam. [Solution] This laser processing machine is provided with: a laser oscillating unit (4) which generates a laser beam (LB1) emitted to a first area (AR1) of a workpiece (W) and a laser beam (LB2) emitted to a second area (AR2) of the workpiece around the first area; and a control unit (7) which changes, on the basis of the board thickness of the workpiece, the output of the laser beam emitted to the first area and the output of the laser beam emitted to the second area in a period in which a pierce hole is formed in the workpiece and a period in which the workpiece is cut.

(57) 要約: 【課題】 レーザ光による切断加工において加工不良の発生を抑制する。 【解決手段】 レーザ加工機は、ワーク(W)の第1領域(AR1)に照射されるレーザ光(LB1)、及びワークのうち第1領域の周囲の第2領域(AR2)に照射されるレーザ光(LB2)を発生するレーザ発振部(4)と、第1領域に照射されるレーザ光の出力および第2領域に照射されるレーザ光の出力を、ワークの板厚に基づいて、ワークにピアス穴を形成する期間とワークを切断する期間とで変化させる制御部(7)と、を備える。

WO 2017/134964 A1



MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, 添付公開書類:
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, — 国際調査報告 (条約第 21 条(3))
KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

明 細 書

発明の名称： レーザ加工機およびレーザ加工方法

技術分野

[0001] 本発明は、レーザ加工機およびレーザ加工方法に関する。

背景技術

[0002] レーザ加工機は、ワークを切断することに利用されている（例えば、下記の特許文献1参照）。レーザ加工機によってワークを切断する場合、ワークにピアス穴を形成した後に、ワークとレーザヘッドとを相対移動させながらピアス穴を起点としてワークを切断する。切断加工の対象となるワークは、例えば、薄板の場合もあれば、中厚板の場合もあるし、厚板の場合もある。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：特開2014-18800号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] 上述のようにレーザ光によって切断加工を行う場合、ワークの板厚によっては加工品質あるいは加工速度が低下することがある。例えば、レーザ光の出力（強度）を薄板に合わせて設定すると、厚板を切断する場合に、アシストガスがワークの下面側へ効率よく流れないこと等により切断面が揺らいでしまうことで加工品質が低下し、また切断速度が低下する。また、レーザ光の出力を厚板に合わせて設定すると、薄板にピアス穴を形成する際にスパッタ（溶融物）のワーク表面への付着が増加することで、加工品質が低下する。

[0005] 本発明は、上述の事情に鑑み、ワークの板厚に応じたレーザ光に制御して、最適な加工品質、加工速度を実現することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0006] 本発明のレーザ加工機は、ワークの第1領域に照射されるレーザ光、及び

ワークのうち第1領域の周囲の第2領域に照射されるレーザ光を発生するレーザ発振部と、第1領域に照射されるレーザ光の出力および第2領域に照射されるレーザ光の出力を、ワークの板厚に基づいて、ワークにピアス穴を形成する期間とワークを切断する期間とで変化させる制御部と、を備える。

[0007] 本発明のレーザ加工方法は、ワークの第1領域に照射されるレーザ光を発生することと、ワークのうち第1領域の周囲の第2領域に照射されるレーザ光を発生することと、第1領域に照射されるレーザ光の出力および第2領域に照射されるレーザ光の出力を、ワークの板厚に基づいて、ワークにピアス穴を形成する期間とワークを切断する期間とで変化させることと、を含む。

[0008] また、制御部は、第1の板厚のワークにピアス穴を形成する期間に第2領域に照射されるレーザ光の出力と比較して、第1の板厚よりも厚い第2の板厚のワークにピアス穴を形成する期間に第2領域に照射されるレーザ光の出力を増加させてもよい。また、制御部は、ワークにピアス穴を形成する期間内で第2領域に照射されるレーザ光の出力を増加させてもよい。また、制御部は、第1領域に照射されるレーザ光の出力を、ワークを切断する期間においてワークにピアス穴を形成する期間よりも減少させてもよい。また、制御部は、ワークを切断する際の切断幅に対してピアス穴の径が同寸法以上になるように、ワークに照射されるレーザ光のビーム径を調整してもよい。また、レーザ照射部は、第1領域に照射されるレーザ光を発生する第1発振器と、第2領域に照射されるレーザ光を発生する第2発振器と、を備え、制御部は、第1発振器の出力および第2発振器の出力を制御してもよい。また、第1発振器は、光ファイバのうち内側の内層にレーザ光を供給し、第2発振器は、光ファイバのうち内層の外側の外層にレーザ光を供給してもよい。また、制御部は、ワークに対する加工条件を定めた加工データに基づいて、第1領域に照射されるレーザ光の出力および第2領域に照射されるレーザ光の出力を制御してもよい。

発明の効果

[0009] 本発明によれば、ワークの第1領域に照射されるレーザ光の出力と、第2

領域に照射されるレーザ光の出力とを、ワークの板厚に基づいて、ピアス穴を形成する期間とワークを切断する期間とで変化させるので、レーザ光の強度分布をピアス穴の形成に適した分布とワークの切断に適した分布とに切り替えることができ、板厚、材質に適したレーザ光に制御して、最適な加工品質、加工速度を実現することができる。

[0010] また、制御部は、第1の板厚のワークにピアス穴を形成する期間に第2領域に照射されるレーザ光の出力と比較して、第1の板厚よりも厚い第2の板厚のワークにピアス穴を形成する期間に第2領域に照射されるレーザ光の出力を増加させる場合、例えば、第1の板厚のワークを加工する際に溶融物の飛散を抑制することができ、第2の板厚のワークを加工する際にアシストガスをワークの下面側へ効率よく流すことができるので、最適な加工品質、加工速度を実現することができる。また、制御部は、ワークにピアス穴を形成する期間内で第2領域に照射されるレーザ光の出力を増加させる場合、第1領域の外側の第2領域に照射されるレーザ光の出力が増加するので、ピアス穴の径を次第に広げるようにピアス穴を形成することができ、ピアス穴を最適な加工品質で形成することができる。また、制御部は、第1領域に照射されるレーザ光の出力を、ワークを切断する期間においてワークにピアス穴を形成する期間よりも減少させる場合、例えば、第1領域に照射されるレーザ光による溶融物が外側に広がることを抑制することができ、切断線を最適な加工品質で形成することができる。また、制御部は、ワークを切断する際の切断幅に対してピアス穴の径が同寸法以上になるように、ワークに照射されるレーザ光のビーム径を調整する場合、ワークの切断を開始する際の溶融物の飛散を抑制することなどができ、最適な加工品質、加工速度を実現することができる。また、レーザ照射部は、第1領域に照射されるレーザ光を発生する第1発振器と、第2領域に照射されるレーザ光を発生する第2発振器と、を備え、制御部は、第1発振器の出力および第2発振器の出力を制御する場合、第1領域と第2領域とで別の発振器を用いるので、レーザ光の出力を第1領域と第2領域とで独立して制御することが容易になる。また、第1発

振器は、光ファイバのうち内側の内層にレーザ光を供給し、第2発振器は、光ファイバのうち内層の外側の外層にレーザ光を供給する場合、光ファイバの内層を介して第1領域に照射されるレーザ光の出力と、光ファイバの外層を介して第2領域に照射されるレーザ光の出力とを簡易な構成で調整することができる。また、制御部は、ワークに対する加工条件を定めた加工データに基づいて、第1領域に照射されるレーザ光の出力および第2領域に照射されるレーザ光の出力を制御する場合、例えば、第1領域に照射されるレーザ光の出力および第2領域に照射されるレーザ光の出力を自動的に制御することができ、生産性が高くなる。

図面の簡単な説明

- [0011] [図1]実施形態に係るレーザ加工機を示す概念図である。
- [図2]実施形態に係るレーザ加工機における光路、照射領域を示す概念図である。
- [図3]レーザ加工機のビームモードを示す説明図である。
- [図4]薄板用の加工モード、厚板用の加工モードの動作説明図である。
- [図5]パルス発振を用いる際の発振器の動作を示す説明図である。
- [図6]実施形態に係るレーザ加工方法を示すフローチャートである。

発明を実施するための形態

- [0012] 以下、図面を参照しながら実施形態について説明する。以下の各図において、X Y Z座標系を用いて図中の方向を説明する。このX Y Z座標系においては、鉛直方向をZ方向とし、水平方向をX方向、Y方向とする。
- [0013] 図1は、実施形態に係るレーザ加工機を示す概念図である。レーザ加工機1は、板状のワークWに対してレーザ光LBを照射し、ワークWを切断することができる。レーザ加工機1は、ワークWを切断する際に、まずピアス穴（貫通孔）を形成し、ピアス穴を起点としてワークWを切断する。レーザ加工機1は、加工パレット2、加工ヘッド3、レーザ発振部4、ヘッド駆動部5、ヘッド制御部6、レーザ制御部7、及び制御装置8を備える。
- [0014] 加工パレット2は、例えば、矩形板状の基台上に複数の支持プレート2a

が起立した状態で形成されている。複数の支持プレート 2 a は、X 方向に並んで配置され、それぞれの上端が鋸歯状である。ワーク W は、複数の支持プレート 2 a 上に載置され、水平面（X Y 平面）に沿って支持される。加工パレット 2 は、不図示の駆動装置によって例えば X 方向に移動可能である。

[0015] 加工パレット 2 は、例えば、レーザ加工を行う加工領域（加工ヘッド 3 の可動範囲）から離れた位置で未加工のワーク W が載置される、加工パレット 2 は、ワーク W を載置したまま移動することにより加工領域にワーク W を搬入する。加工ヘッド 3 によるレーザ加工は、加工パレット 2 に載置された状態のワーク W に対して行われる。レーザ加工後のワーク W は、加工パレット 2 に載置されたまま、加工パレット 2 の移動により加工領域から搬出される。なお、上記した加工パレット 2 は一例であって、他の形態であってもよい。例えば、鋸歯状の支持プレートに代えて、上端が波形の支持プレートでもよく、また、複数のピンが加工パレット 2 の基台上に形成され、これらピンの上端でワーク W を支持してもよい。

[0016] レーザ発振部 4 は、例えばファイバレーザなどであり、レーザ光 L B を発生する。レーザ発振部 4 は、第 1 発振器 1 1 および第 2 発振器 1 2 を備える。レーザ発振部 4 からのレーザ光 L B は、光ファイバ 1 3 を介して加工ヘッド 3 に導入される。加工ヘッド 3 は、加工パレット 2 に載置されたワーク W の上方（Z 方向）に配置可能である。加工ヘッド 3 は、レーザ発振部 4 からのレーザ光 L B をワーク W 上に集光する光学系 1 4 を内部に有し、光学系 1 4 を介してレーザ光 L B をワーク W に向けて照射する。

[0017] 図 2 は、実施形態に係るレーザ加工機におけるレーザ光の光路、及び照射領域を示す概念図である。図 2（A）には、光ファイバ 1 3 からワーク W までの光路を示した。また、図 2（B）には、レーザ発振部 4 からワーク W までの光路を直線的に展開して概念的に示した。光学系 1 4 は、光ファイバ 1 3 からワーク W に向かう順に、レンズ 1 4 a、折り曲げミラー 1 5、レンズ 1 4 b、及び保護ガラス 1 6 を備える。光ファイバ 1 3 から出射したレーザ光 L B は、レンズ 1 4 a でコリメートされた後、折り曲げミラー 1 5 で反射

して光路が折れ曲がり、レンズ14bによって集光された後に保護ガラス16を通してワークWに照射される。

[0018] 図2(B)に示すように、第1発振器11および第2発振器12は、それぞれ、レーザ光を発生する。第1発振器11が発生するレーザ光LB1と、第2発振器12が発生するレーザ光LB2とは、同じ波長であるが、異なる波長でもよい。図2(A)に示したレーザ光LBは、図2(B)のレーザ光LB1およびレーザ光LB2の一方のレーザ光または双方を含むレーザ光である。

[0019] 光ファイバ13は、レーザ光が伝搬する層を2以上含む多層構造である。光ファイバ13は、円柱状の内層13aと、内層13aの外周を覆う中間層13bと、中間層13bの外周を覆う円環状の外層13cとを有する。中間層13bは、内層13aとの界面でレーザ光LB1が反射し、外層13cとの界面でレーザ光LB2が反射するドープ層である。第1発振器11からのレーザ光LB1は、内層13aに導入（供給）され、内層13aと中間層13bとの界面で繰り返し反射しながら、加工ヘッド3（図1参照）へ導かれる。第2発振器12からのレーザ光LB2は、外層13cに導入（供給）され、外層13cと中間層13bとの界面および外層13cの外周面で繰り返ししながら、加工ヘッド3へ導かれる。

[0020] 光ファイバ13から射出されたレーザ光LB1、レーザ光LB2は、それぞれ、光学系14に入射する。光学系14のレンズ14aは、コリメータであり、レーザ光LB1、レーザ光LB2をそれぞれ平行化する。光学系14のレンズ14bは、コンデンサであり、レンズ14aからのレーザ光LB1、レーザ光LB2をそれぞれワークW上に集光する。

[0021] 図2(C)は、ワークW上におけるレーザ光の照射領域ARを示す図である。照射領域ARは、ワークWの第1領域（以下、内側領域AR1という）と、ワークのうち第1領域の周囲の第2領域（以下、外側領域AR2という）とを含む。内側領域AR1は、例えば、照射領域ARの中心部に配置される円状の領域である。外側領域AR2は、内側領域AR1の周囲に配置され

る円環状の領域である。内側領域 A R 1 は、光ファイバ 1 3 の内層 1 3 a に対応する領域である。第 1 発振器 1 1 からのレーザ光 L B 1 は、光ファイバ 1 3 の内層 1 3 a を通って、内側領域 A R 1 に照射される。外側領域 A R 2 は、光ファイバ 1 3 の外層 1 3 c に対応する領域である。第 2 発振器 1 2 からのレーザ光 L B 2 は、光ファイバ 1 3 の外層 1 3 c を通って、外側領域 A R 2 に照射される。

[0022] 光学系駆動部 2 1 は、光学系 1 4 のフォーカス位置を調整可能である。例えば、光学系駆動部 2 1 は、光学系 1 4 に含まれるレンズの少なくとも一部を、光学系 1 4 の光軸 A X と平行な方向に移動させ、フォーカス位置を調整する。図 2 (B) に示す内側領域 A R 1 の直径 D 1 および外側領域 A R 2 の直径 D 2 は、それぞれ、ワーク W が光学系 1 4 のフォーカス位置から離れるほど、大きくなる。ワーク W 上のレーザ光 (図 1 のレーザ光 L B) のスポットサイズは、第 1 発振器 1 1 と第 2 発振器 1 2 とのうち第 1 発振器 1 1 のみからレーザ光 L B 1 が照射される場合、直径 D 1 で表される。この場合、ピアス穴の直径、及び切断加工時の切断幅は、直径 D 1 に応じた値になる。また、ワーク W 上のレーザ光のスポットサイズは、第 2 発振器 1 2 からレーザ光 L B 2 が照射される場合、直径 D 2 で表される。この場合、ピアス穴の直径、及び切断加工時の切断幅は、直径 D 2 に応じた値になる。光学系駆動部 2 1 は、光学系 1 4 のフォーカス位置を変更することで、ワーク W 上のレーザ光のスポットサイズを変化させることができる。すなわち、光学系駆動部 2 1 は、ピアス穴の直径、切断幅を調整可能である。なお、ピアス穴の直径、切断幅は、第 1 発振器 1 1 からレーザ光 L B 1 を照射し、かつ第 2 発振器 1 2 からレーザ光 L B 2 を照射しない状態と、第 2 発振器 1 2 からレーザ光 L B 2 を照射する状態とで切り替えることもできる。

[0023] 図 1 の説明に戻り、ヘッド駆動部 5 は、光学系駆動部 2 1、X 駆動部 2 2、Y 駆動部 2 3、及び Z 駆動部 2 4、を備える。X 駆動部 2 2、Y 駆動部 2 3、Z 駆動部 2 4、及び光学系駆動部 2 1 は、それぞれアクチュエータを含む。X 駆動部 2 2 は、ワーク W に対して加工ヘッド 3 を X 方向に移動させる

。Y駆動部23は、ワークWに対して加工ヘッド3をY方向に移動させる。Z駆動部24は、ワークWに対して加工ヘッド3をZ方向に移動させる。ヘッド駆動部5は、ワークWにピアス穴を形成する際に、X駆動部22、Y駆動部23、及びZ駆動部24によってワークWに対して加工ヘッド3を位置決めする。また、ヘッド駆動部5は、ワークWを切断する際に、X駆動部22およびY駆動部23によって、加工ヘッド3をワークWに対して相対的に移動させる。

[0024] ヘッド制御部6は、制御装置8からの指令に基づいて、ヘッド駆動部5を制御する。例えば、ヘッド制御部6は、加工ヘッド3の目標位置および目標速度をヘッド駆動部5に供給する。ヘッド駆動部5のX駆動部22、Y駆動部23、及びZ駆動部24は、加工ヘッドの位置、速度がそれぞれ目標位置、目標速度に近づくように、加工ヘッド3を移動させる。また、ヘッド制御部6は、光学系14のフォーカス位置の目標値をヘッド駆動部5に供給する。ヘッド駆動部5の光学系駆動部21は、光学系14のフォーカス位置が目標値に近づくように、光学系14に含まれるレンズを移動させる。

[0025] レーザ制御部7は、レーザ発振部4を制御する。レーザ制御部7は、ビームモード指令部31および発振モード司令部32を備える。レーザ加工機1は、ワークWに照射されるレーザ光の強度分布が異なる複数のビームモード（後に図3に示す）を備え、ビームモード指令部31は、複数のビームモードを切替可能である。

[0026] ビームモード指令部31は、例えば、ビームモードを指定する指令として、第1発振器11の出力（レーザ光LB1の強度）の目標値と、第2発振器12の出力（レーザ光LB2の強度）の目標値とをレーザ発振部4に供給する。レーザ発振部4は、第1発振器11の出力がビームモード指令部31から供給された目標値に近づくように、第1発振器11をレーザ発振させる（駆動する）。同様に、レーザ発振部4は、第2発振器12の出力がビームモード指令部31から供給された目標値に近づくように、第2発振器12をレーザ発振させる（駆動する）。このように、ビームモード指令部31は、各

発振器の出力の目標値を調整することによって、ワークWに照射されるレーザ光LBの強度分布を調整可能である。

[0027] 発振モード司令部32は、第1発振器11の発振方式および第2発振器12の発振方式をそれぞれ制御する。第1発振器11および第2発振器12は、それぞれ、発振方式をパルス発振および連続発振(CW)から選択可能であり、発振モード司令部32は、パルス発振および連続発振のいずれを選択するかを示す発振モード指令を、レーザ発振部4に供給する。レーザ発振部4は、第1発振器11および第2発振器12を、発振モード指令に指定された発振方式で発振させる。なお、第1発振器11の発振方式および第2発振器12は、パルス発振と連続発振の一方のみが可能でもよい。この場合、発振モード司令部32は、省略可能である。

[0028] 制御装置8は、外部から供給される加工データに基づいて、レーザ加工機1の各部を包括的に制御する。加工データは、例えば、加工条件を定めたNCデータである。加工条件は、ワークWの材質、板厚、切断線の位置、各工程の内容などである。加工データには、各工程の内容(切断線の始点、終点、切断速度)が工程順に並んでいる。制御装置8は、加工データに基づいて、ヘッド制御部6およびレーザ制御部7のそれぞれに指令を供給する。レーザ制御部7の発振モード司令部32は、制御装置8からの指令に基づいて、レーザ発振部4の発振方式を設定する。

[0029] また、レーザ制御部7のビームモード指令部31は、制御装置8からの指令に基づいて、ビームモード(第1発振器11の出力および第2発振器12の出力)を、ワークWの板厚に基づいて設定する。すなわち、レーザ制御部7のビームモード指令部31は、ワークWに対する加工条件を定めた加工データに基づいて、第1発振器11の出力および第2発振器12の出力を制御する。ビームモード指令部31は、ワークWにピアス穴を形成する期間(ピアス加工)と、ワークWを切断する期間(切断加工)とでビームモードを変化させる。

[0030] 図3は、複数のビームモードを示す説明図である。ここでは、複数のビー

ムモードとして、モードA、モードB、モードC、モードD、及びモードEの5つのモードが設けられる例を説明する。図3には、内側領域AR1および外側領域AR2におけるレーザ光の出力（強度）の空間的な分布を示した。図3の縦軸は、レーザ光の出力の最大出力に対する比率である。PW0は、例えば0%（オフ状態）であり、PW3は、例えば100%（最大出力）である。また、PW1、PW2は、それぞれ、PW0よりも大きくPW3よりも小さい出力（第1中間出力、第2中間出力）である。PW2は、PW1よりも大きく、例えば、PW1が25%であり、PW2が50%である。

[0031] モードAにおいて、内側領域AR1におけるレーザ光の出力はPW3であり、外側領域AR2におけるレーザ光の出力はPW0である。モードBは、モードAに比べて、外側領域AR2のレーザ光の出力を大きくしたモードである。モードBにおいて、内側領域AR1におけるレーザ光の出力はPW3であり、外側領域AR2におけるレーザ光の出力はPW3である。モードCは、モードBに比べて、内側領域AR1のレーザ光の出力を小さくしたモードである。モードCにおいて、内側領域AR1におけるレーザ光の出力がPW2であり、外側領域AR2におけるレーザ光の出力がPW3である。モードDは、モードCと比べて、内側領域AR1のレーザ光の出力をさらに小さくしたモードである。モードDにおいて、内側領域AR1におけるレーザ光の出力がPW1であり、外側領域AR2におけるレーザ光の出力がPW3である。モードEは、モードDと比べて、内側領域AR1のレーザ光の出力をさらに小さくしたモードである。モードEにおいて、内側領域AR1におけるレーザ光の出力がPW0であり、外側領域AR2におけるレーザ光の出力がPW3である。

[0032] 上述の内側領域AR1におけるレーザ光の出力は第1発振器11の出力に対応し、外側領域AR2におけるレーザ光の出力は、第2発振器12の出力に対応する。ビームモード指令部31は、ワークWの板厚に基づいて、第1発振器11の出力および第2発振器12の出力を変化させる。ここでは、第1の板厚のワーク（例、薄板）に対する加工モード（薄板用の加工モード）

、及び第1の板厚よりも厚い第2の板厚のワーク（例、厚板）に対する加工モード（厚板用の加工モード）を例に挙げて説明する。例えば、薄板は、板厚が1 mm以上3 mm以下の板材であり、厚板は、板厚が10 mm以上あるいは12 mm以上の板材である。

[0033] ビームモード指令部31は、例えば、加工データに含まれるワークWの板厚に基づいて、薄板用の加工モードを適用するか、厚板用の加工モードを適用するかを判定する。例えば、ビームモード指令部31は、加工データに含まれるワークWの板厚が閾値以上である場合に厚板用の加工モードを適用すると判定し、それ以外の場合に薄板用の加工モードを適用すると判定する。なお、ビームモード指令部31は、加工データに含まれるワークWの板厚が閾値以下である場合に薄板用の加工モードを適用すると判定し、それ以外の場合に厚板用の加工モードを適用すると判定してもよい。また、薄板用の加工モードを用いるのか、厚板用の加工モードを用いるのかについては、例えば、オペレータが制御装置8を介して指定してもよい。この場合、ビームモード指令部31は、いずれの加工モードを用いるのかを判定しなくてもよい。また、レーザ加工機1は、薄板用の加工モードと厚板用の加工モードと以外の加工モードを有してもよく、例えば、極薄板用の加工モードあるいは中厚板用の加工モードを有してもよい。

[0034] 図4（A）は、薄板用の加工モードの説明図であり、図4（B）は、厚板用の加工モードの説明図である。ここでは、連続発振である場合とし、パルス発振の場合については後に図5で説明する。まず、薄板用の加工モードについて説明する。ヘッド駆動部5は、ヘッド制御部6に制御され、加工データに定められたワークW上の切断線の起点の位置（ピアス穴の形成位置）に、加工ヘッド3を位置決めする。ビームモード指令部31は、図4（A）に示すように、ビームモードをモードAに設定して、第1発振器11に出力がPW3のレーザ光LB1を発生させ、レーザ光LB1を内側領域AR1に照射させる。また、ビームモード指令部31は、第2発振器12にレーザ発振を行わない状態を維持する。レーザ光LB1が内側領域AR1に所定の時間

だけ照射されることで、ワークWにピアス穴が形成される。

[0035] なお、薄板用の加工モードにおいて、ピアス穴の直径は、ワークW上のレーザ光LB1のスポットサイズに対応する。レーザ光LB1の照射に先立ち、光学系駆動部21は、ヘッド制御部6に制御され、光学系14のフォーカス位置をワークWからずらすこと（デフォーカス）によって、切断幅に対してピアス穴の直径が大きくなるように、ワークW上のレーザ光LB1のスポットサイズを広げる。

[0036] また、光学系駆動部21は、ヘッド制御部6に制御され、ピアス穴が形成された後（上記の所定の時間の経過後）に、ワークW上のレーザ光LB1のスポットサイズを切断幅に合わせるように、光学系14のフォーカス位置を調整する。ヘッド駆動部5は、光学系14のフォーカス位置が調整された後に、ワークW上のレーザ光LB1が切断線に沿って移動するように、加工ヘッド3を移動させる。この際、ビームモード指令部31は、ビームモードをモードAに維持しておく。すなわち、薄板用の加工モードを適用する場合、ビームモード指令部31は、ピアス加工および切断加工のそれぞれにおいて、ビームモードをモードAに設定する。

[0037] 次に、厚板用の加工モードについて説明する。ヘッド駆動部5は、ピアス穴の形成位置に、加工ヘッド3を位置決めする。ビームモード指令部31は、図4（B）に示すように、ビームモードをモードAに設定して、第1発振器11に出力がPW3のレーザ光LB1を発生させ、レーザ光LB1を内側領域AR1に照射させる。ビームモード指令部31は、モードAで所定の時間だけレーザ光が照射された時点で、ビームモードをモードBに設定する。すなわち、ビームモード指令部31は、第2発振器12に出力がPW3のレーザ光LB2を発生させ、レーザ光LB2を外側領域AR2に照射させる。

[0038] ビームモード指令部31は、モードBで所定の時間だけレーザ光が照射された時点で、ビームモードをモードCに設定する。すなわち、ビームモード指令部31は、第1発振器11に出力をPW2に変更し、出力がPW2のレーザ光LB2を外側領域AR2に照射させる。ビームモード指令部31は、

モードCで所定の時間だけレーザ光が照射された時点で、ビームモードをモードDに設定する。すなわち、ビームモード指令部31は、第1発振器11に出力をPW1に変更し、出力がPW1のレーザ光LB2を外側領域AR2に照射させる。以上のようなモードAからモードDでレーザ光が照射されることにより、ピアス穴が形成される。

[0039] 図4(A)および図4(B)を比較すると分かるように、第2発振器12の出力は、第1の板厚のワーク(例、薄板)にピアス穴を形成する期間においてPW0に設定されるのに対し、第1の板厚よりも厚い第2の板厚のワーク(例、厚板)にピアス穴を形成する期間においてPW3に設定される。このように、制御部(ビームモード指令部31)は、薄板にピアス穴を形成する期間における第2発振器12の出力と比較して、厚板にピアス穴を形成する期間における第2発振器12の出力を増加させる。

[0040] また、図4(B)に示すように、第1発振器11の出力は、モードAおよびモードBにおいてPW3に設定されるのに対して、モードBよりの後のモードCおよびモードDでは、PW2、PW1と順に減少するように設定される。このように、制御部(ビームモード指令部31)は、ワークWにピアス穴を形成する期間内で第1発振器11の出力を減少させる。また、第2発振器12の出力は、モードAにおいてPW0に設定されるのに対し、モードBからモードDではPW3に設定される。このように、制御部(ビームモード指令部31)は、ワークWにピアス穴を形成する期間内で第2発振器12の出力を増加させる。

[0041] なお、厚板用の加工モードにおいて、ピアス穴の直径は、ワークW上のレーザ光LB2のスポットサイズに対応する。レーザ光LB2の照射に先立ち、光学系駆動部21は、ヘッド制御部6に制御され、光学系14のフォーカス位置をワークWからずらすこと(デフォーカス)によって、切断幅に対してピアス穴の直径が同寸法以上になるように、ワークW上のレーザ光LB2のスポットサイズを広げる。

[0042] レーザ加工機1は、ピアス穴が形成された後(ピアス加工の終了後)に切

断加工を開始する。光学系駆動部 21 は、ヘッド制御部 6 に制御され、ピアス穴の形成後に、ワーク W 上のレーザ光 LB2 のスポットサイズ（図 2 の外側領域 AR2 の直径）を切断幅に合わせるように、光学系 14 のフォーカス位置を調整する。ビームモード指令部 31 は、切断加工において、ビームモードをモード E に設定する。すなわち、ビームモード指令部 31 は、第 1 発振器 11 に出力を PW0 に変更し、レーザ光 LB2 の照射を停止させる。このように、制御部（ビームモード指令部 31）は、第 1 発振器 11 の出力を、ワーク W を切断する期間においてワーク W にピアス穴を形成する期間よりも減少させる。ヘッド駆動部 5 は、ビームモードがモード E に変更された後、ワーク W 上のレーザ光 LB1 が切断線に沿って移動するように、加工ヘッド 3 を移動させる。

[0043] 次に、レーザ発振部 4 をパルス発振させる際の動作について説明する。図 5 は、実施形態に係るレーザ加工機の発振器のパルス発振時の動作を示す説明図である。第 1 発振器 11 および第 2 発振器は、それぞれ、パルス発振時に予め定められた強度のレーザ光を間欠的に発生する。図 5（A）には、各レーザ光の出力（PW0～PW3）に対応するレーザ発振のオン、オフのタイミングを示した。ここでは、出力が PW3 の場合、連続発振が用いられ、出力が PW1、PW2 の場合、パルス発振が用いられる。

[0044] 出力が PW0 に設定される場合、レーザ発振はオフに維持される。出力が PW1 に設定される場合、パルス周期 T_a に対してパルス幅が T_{b1} に設定される。パルス周期 T_a は、パルスの立ち上がり（レーザ発振が開始する）時点から、次のパルスの立ち上がり時点までの時間である。また、パルス幅 T_{b1} は、1 つのパルスの立ち上がり時点から立ち下り（レーザ発振が終了する）時点までの時間である。レーザ光の単位時間あたりの出力は、パルス周期 T_a に占めるパルス幅 T_{b1} の比率（デューティ）と対応する。レーザ光の単位時間あたりの出力は、 T_{b1} / T_a が大きくなるほど、大きい。例えば、PW1 が 25% である場合、 T_{b1} / T_a は 0.25 に設定されてもよい。出力が PW2 に設定される場合、パルス周期 T_a に対してパルス幅が

Tb2に設定される。パルス幅Tb2は、出力がPW1に設定される場合の
パルス幅Tb1よりも長い。例えば、PW2が50%である場合、Tb1/
Taは0.5に設定されてもよい。出力がPW3に設定される場合、発振器
を連続発振させ、レーザ発振をオンに維持する。なお、出力がPW3に設定
される場合にも、発振器をパルス駆動してもよく、この場合、各出力に対応
するパルス幅を適宜調整すればよい。

[0045] 図5(B)は、各ビームモードにおける第1発振器11および第2発振器
12の動作を示す図である。モードAにおいて、第1発振器11は、連続発
振に設定され、第2発振器は、レーザ発振がオフに維持される。モードBに
おいて、第1発振器11は、連続発振に設定され、第2発振器は、連続発振
に設定される。モードCにおいて、第1発振器11は、パルス幅がTb2に
設定され、第2発振器は、連続発振に設定される。モードDにおいて、第1
発振器11は、パルス幅がTb1に設定され、第2発振器は、連続発振に設
定される。モードEにおいて、第1発振器11は、レーザ発振がオフに維持
され、第2発振器は、連続発振に設定される。

[0046] 上述のように第1発振器11および第2発振器12がパルス発振される場
合においても、図4(B)と同様に、ビームモードを切替ながらピアス加工
、切断加工を行うことができる。なお、パルス発振させる場合に、パルス幅
を複数のビームモードで一定値とし、パルスの振幅(強度)を変化させるこ
とで、レーザ光の出力を変化させてもよい。また、第1発振器11および第
2発振器12の少なくとも一方は、複数のレーザ光源(例、複数の発振器)
を備えてもよく、複数のレーザ光源のうち点灯させるレーザ光源の数を変化
させることで、レーザ光の総出力を調整してもよい。例えば、第1発振器1
1は、4つのレーザ光源を備え、2つを点灯させ2つを消灯させることで出
力を50%とし、1つを点灯させ3つを消灯させることで出力を25%にし
てもよい。

[0047] なお、本実施形態において、レーザ発振部4は、内側領域AR1に照射さ
れるレーザ光LB1を第1発振器11で発生させ、外側領域AR2で照射さ

れるレーザ光LB2を第2発振器12で発生させており、照射領域ARの領域ごとに担当する発振器を分けた構成であるが、このような構成に限定されない。例えば、レーザ発振器4は、1つの発振器で発生したレーザ光を分岐させ、分岐した一方のレーザ光を光ファイバ13の内層13aに導入し、分岐した他方のレーザ光を光ファイバ13の外層13cに導入する構成でもよい。レーザ光を分岐させるには、ハーフミラーを用いてもよいし、回折格子などを用いてもよい。また、分岐した片方のレーザ光と、もう片方のレーザ光とで出力を調整するには、例えば、片方のレーザ光をシャッタなどで遮光してもよいし、減光フィルタなどを用いて一方のレーザ光と他方のレーザ光とで光量を調整してもよい。

[0048] 次に、上述のレーザ加工機1の動作に基づき、実施形態に係るレーザ加工方法について説明する。図5は、実施形態に係るレーザ加工方法を示すフローチャートである。ステップS1において、制御装置8は、加工条件を取得する。例えば、制御装置8には、加工データが供給され、制御装置8は、加工データに定められた加工条件を取得する。ここでは、ワークWが厚板である場合について説明する。ステップS2において、制御装置8は、アシストガスの噴射を開始させる。ステップS3において、ヘッド駆動部5は、ヘッド制御部6に制御されて加工ヘッド3を移動させ、加工ヘッド3をピアス穴の形成位置に対して位置決めする。

[0049] ステップS4において、レーザ発振部4は、第1発振器11の出力および第2発振器12の出力を定めたビームモード指令を取得する。ステップS5において、レーザ発振部4は、第1発振器11の発振方式および第2発振器の発振方式を定めた発振モード指令を取得する。ビームモード指令は、レーザ制御部7のビームモード指令部31によって、ワークWの板厚、及び加工の段階に応じて生成される。

[0050] ステップS6において、レーザ発振部4は、第1発振器11および第2発振器12のそれぞれの発振条件（出力、発振モード、発振時間）を設定する。そして、レーザ発振部4は、設定した発振条件に従って、第1発振器11

および第2発振器12のそれぞれを発振させる。例えば、ピアス加工を開始した際に、レーザ発振部4は、図4（B）のモードAで第1発振器11および第2発振器12のそれぞれを動作させる。

[0051] レーザ発振部4は、発振条件に定められた発振時間の経過後に、ステップS7においてピアス加工が終了したか否かを判定する。レーザ発振部4は、図4（B）に示したモードDによる加工が終了していない場合、ピアス加工が終了していないと判定（ステップS7；No）し、ステップS4に戻り次のビームモード指令を取得する。例えば、ビームモード指令部31は、モードAでの加工の次にモードBでの加工を行うことを示すビームモード指令を生成し、レーザ発振部4は、このビームモード指令を取得する。以下同様に、レーザ発振部4は、ステップS4からステップS7の処理を繰り返し行い、モードAでの加工からモードDでの加工までを順に行う。

[0052] ステップS7において、レーザ発振部4は、図4（B）に示したモードDによる加工が終了している場合、ピアス加工が終了した判定（ステップS7；No）し、ステップS8において、第1発振器11および第2発振器12のそれぞれの発振条件を変更する。例えば、レーザ発振部4は、ビームモードを図4（B）のモードEに設定し、第1発振器11からのレーザ発振を停止させる。ステップS9において、ヘッド駆動部5は、ヘッド制御部6に制御され、切断線に沿って加工ヘッド3を移動させる。ヘッド制御部6は、加工データに定められた1つの工程（例、1つの切断線の切断）が終了した際に、ステップS10において、切断加工が終了したか否かを判定する。ヘッド制御部6は、制御装置8から指令される次の工程がある場合に、切断加工が終了していないと判定（ステップS10；No）し、ステップS9に戻り、次の工程（例、次の切断線の切断）に応じて加工ヘッド3を移動させる。ステップS10において、ヘッド制御部6は、制御装置8から指令される次の工程がない場合に、切断加工が終了したと判定（ステップS10；Yes）し、一連の処理を終了する。なお、レーザ制御部7は、制御装置8から指令に応じて、切断加工の終了時にレーザ光の照射を停止させる。

[0053] なお、図3では複数のビームモードとしてモードAからモードEを例示したが、モードAからモードDのうち1以上のモードは省略可能である。例えば、上述の実施形態において、ピアス加工を行う際にモードAからモードDを順に切り替えることとしたが、モードAからモードDのいずれか1つを用いてピアス加工を行ってもよい。また、AからモードDのうち1以上のモードを省略し、2つ以上のモードを用いてピアス加工を行ってもよく、例えば、モードDを省略し、モードAからモードCを順に行ってもよい。また、切断加工を行う際に、内側領域AR1にレーザ光LB1を照射してもよく、例えば、モードEの代わりにモードDを用いて切断加工を行ってもよい。この場合、レーザ加工機1は、モードEを備えなくてもよい。また、レーザ加工機1は、モードAからモードEのいずれとも違うビームモードを有してもよい。例えば、ピアス加工を開始する際に、上述の実施形態では外側領域AR2にレーザ光LB2を照射しないこととしたが、モードAの代わりに、モードBよりも出力が小さいモードを設け、レーザ光LB2を外側領域AR2に照射してもよい。また、上述の実施形態では、モードAからモードEのそれぞれにおいてレーザ光の出力が一定であり、モードAからモードEへ切り替えることで、レーザ光の出力を段階的に切り替えることとしたが、レーザ光の出力を連続的に変化させてもよい。例えば、モードCおよびモードDの代わりに、レーザ光LB1の出力がPW3からPW0へ連続的に変化するモードが設けられてもよい。また、PW1からPW3の出力は、それぞれ、25%、50%、100%であるとして説明したが、0%より大きく100%以下の任意の値に設定される。

[0054] 上述の実施形態において、レーザ制御部7は、例えばコンピュータシステムを含む。レーザ制御部7は、記憶装置（図示せず）に記憶されているプログラム（制御プログラム）を読み出し、このプログラムに従って各種の処理を実行する。このプログラムは、コンピュータに、ワークWの内側領域AR1に照射されるレーザ光LB1を発生させることと、ワークWのうち内側領域AR1の周囲の外側領域AR2に照射されるレーザ光LB2を発生させる

ことと、内側領域 A R 1 に照射されるレーザ光 L B 1 の出力および外側領域 A R 2 に照射されるレーザ光 L B 2 の出力を、ワーク W の板厚に基づいて、ワーク W にピアス穴を形成する期間とワーク W を切断する期間とで変化させることと、を実行させる。このプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記録されて提供されてもよい。

[0055] なお、本発明の技術範囲は、上述の実施形態などで説明した態様に限定されない。上述の実施形態などで説明した要件の 1 つ以上は、省略されることがある。また、上述の実施形態などで説明した要件は、適宜組み合わせることができる。また、法令で許容される限りにおいて、日本特許出願である特願 2 0 1 6 - 0 2 0 4 5 8、及び本明細書で引用した全ての文献の開示を援用して本文の記載の一部とする。

符号の説明

[0056] 1 . . . レーザ加工機
7 . . . レーザ制御部（制御部）
1 1 . . . 第 1 発振器
1 2 . . . 第 2 発振器
1 3 . . . 光ファイバ
1 3 a . . . 内層
1 3 c . . . 外層
1 4 . . . 光学系
A R 1 . . . 内側領域（第 1 領域）
A R 2 . . . 外側領域（第 2 領域）
L B 1、L B 2 . . . レーザ光
W . . . ワーク

請求の範囲

- [請求項1] ワークの第1領域に照射されるレーザ光、及び前記ワークのうち前記第1領域の周囲の第2領域に照射されるレーザ光を発生するレーザ発振部と、
- 前記第1領域に照射されるレーザ光の出力および前記第2領域に照射されるレーザ光の出力を、前記ワークの板厚に基づいて、前記ワークにピアス穴を形成する期間と前記ワークを切断する期間とで変化させる制御部と、を備えるレーザ加工機。
- [請求項2] 前記制御部は、第1の板厚の前記ワークにピアス穴を形成する期間に前記第2領域に照射されるレーザ光の出力と比較して、前記第1の板厚よりも厚い第2の板厚の前記ワークにピアス穴を形成する期間に前記前記第2領域に照射されるレーザ光の出力を増加させる、請求項1に記載のレーザ加工機。
- [請求項3] 前記制御部は、前記第2の板厚の前記ワークにピアス穴を形成する期間内で前記第2領域に照射されるレーザ光の出力を増加させる、請求項2に記載のレーザ加工機。
- [請求項4] 前記制御部は、前記第2の板厚の前記ワークを切断する期間において前記ワークにピアス穴を形成する期間よりも、前記第1領域に照射されるレーザ光の出力を減少させる、請求項2または請求項3に記載のレーザ加工機。
- [請求項5] 前記制御部は、前記ワークを切断する際の切断幅に対して前記ピアス穴の径が同寸法以上になるように、前記ワークに照射されるレーザ光のビーム径を調整する、請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のレーザ加工機。
- [請求項6] 前記レーザ照射部は、
- 前記第1領域に照射されるレーザ光を発生する第1発振器と、
- 前記第2領域に照射されるレーザ光を発生する第2発振器と、を備え、

前記制御部は、前記第 1 発振器の出力および前記第 2 発振器の出力を制御する、請求項 1 から請求項 5 のいずれか一項に記載のレーザ加工機。

[請求項7] 前記第 1 発振器は、光ファイバのうち内側の内層にレーザ光を供給し、

前記第 2 発振器は、前記光ファイバのうち前記内層の外側の外層にレーザ光を供給する、請求項 6 に記載のレーザ加工機。

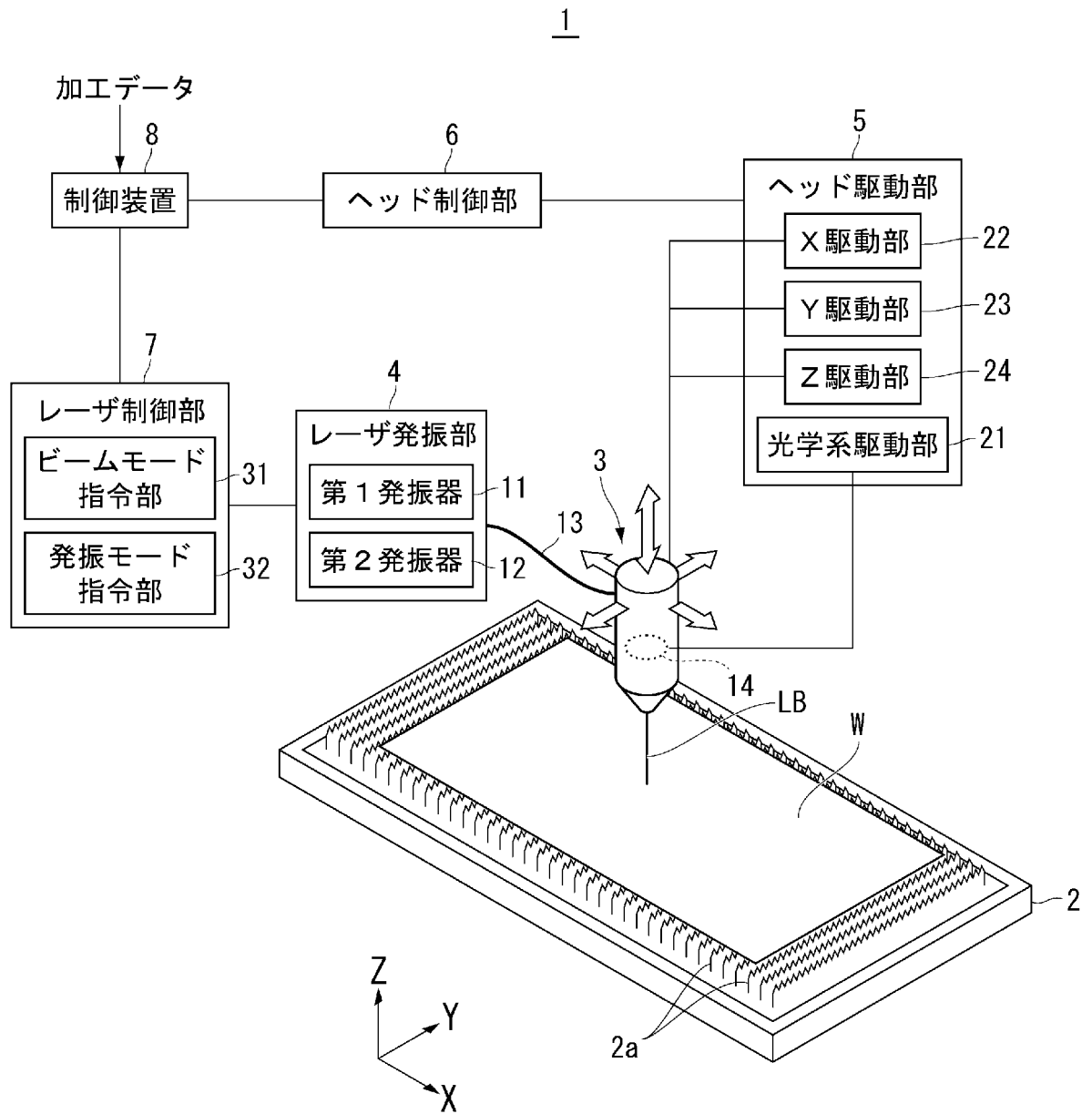
[請求項8] 前記制御部は、前記ワークの板厚を含む加工条件を定めた加工データに基づいて、前記第 1 領域に照射されるレーザ光の出力および前記第 2 領域に照射されるレーザ光の出力を決定する、請求項 1 から請求項 6 のいずれか一項に記載のレーザ加工機。

[請求項9] ワークの第 1 領域に照射されるレーザ光を発生することと、

前記ワークのうち前記第 1 領域の周囲の第 2 領域に照射されるレーザ光を発生することと、

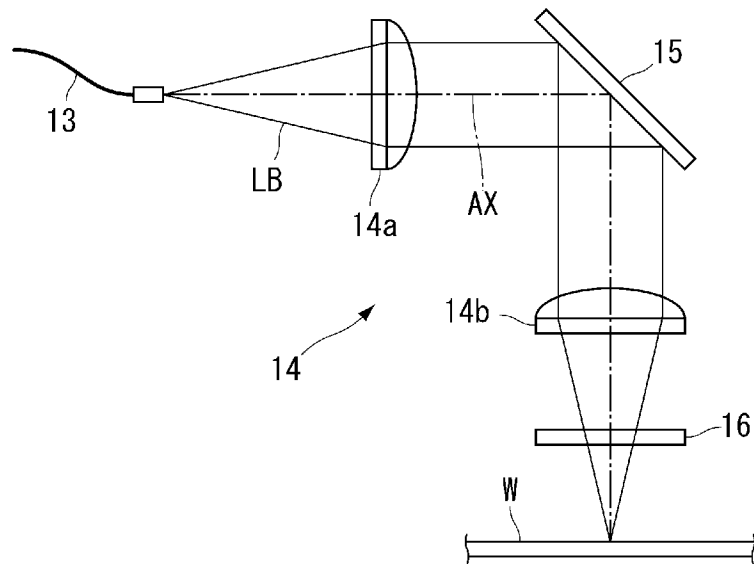
前記第 1 領域に照射されるレーザ光の出力および前記第 2 領域に照射されるレーザ光の出力を、前記ワークの板厚に基づいて、前記ワークにピアス穴を形成する期間と前記ワークを切断する期間とで変化させることと、を含むレーザ加工方法。

[図1]

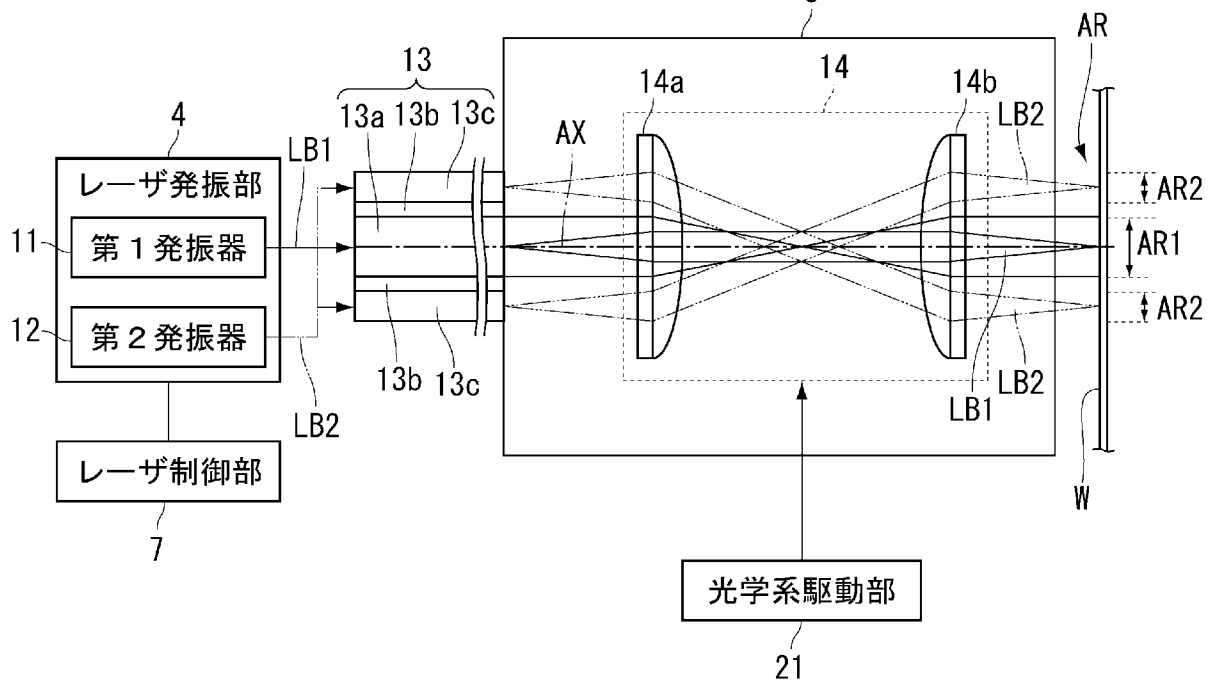


[図2]

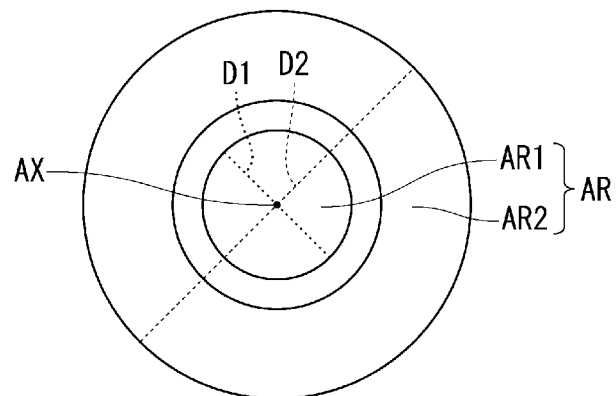
(A)



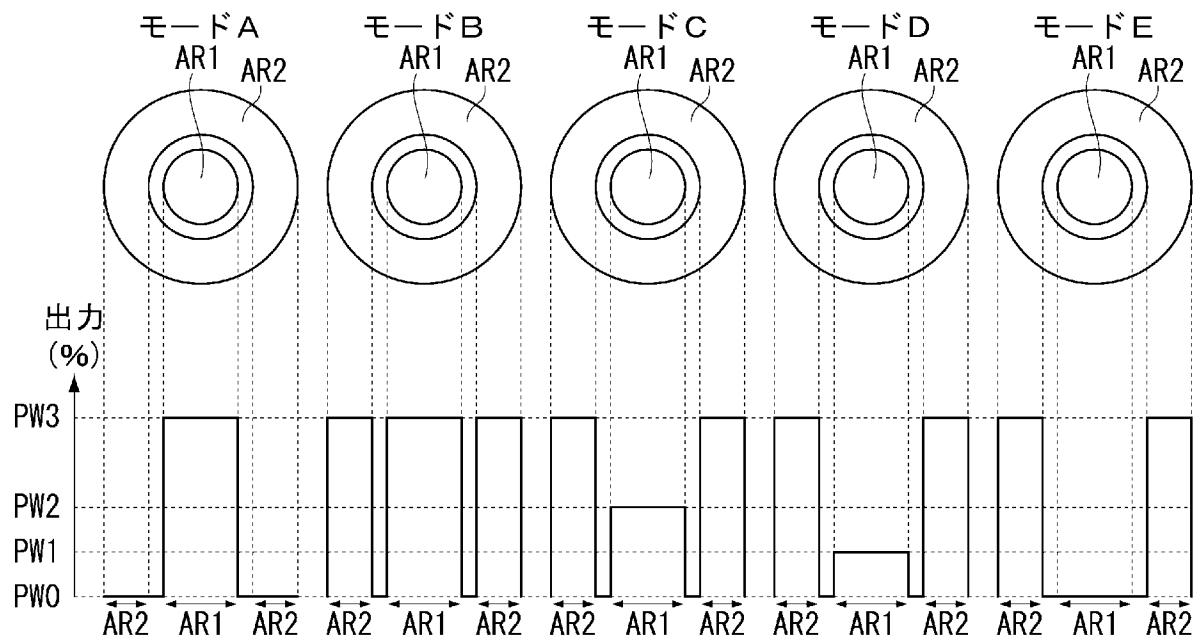
(B)



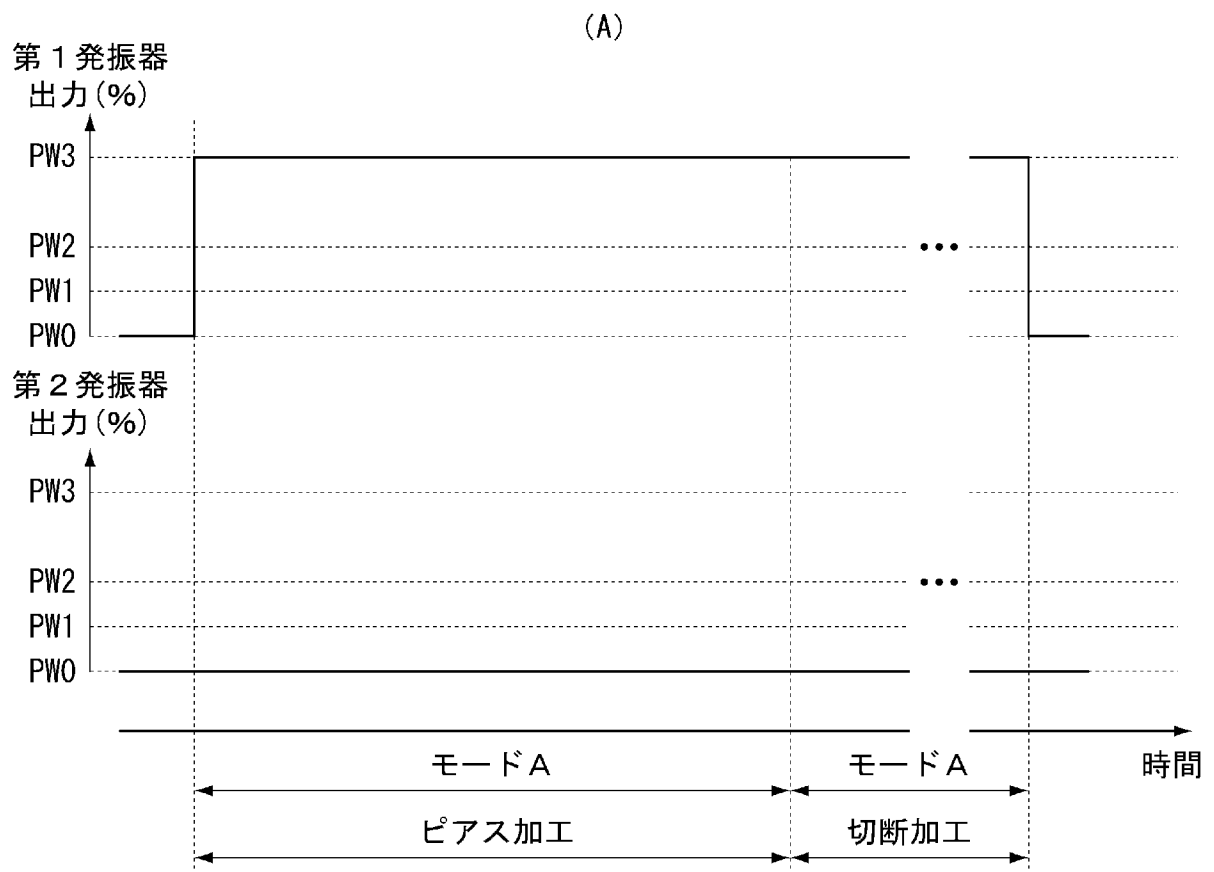
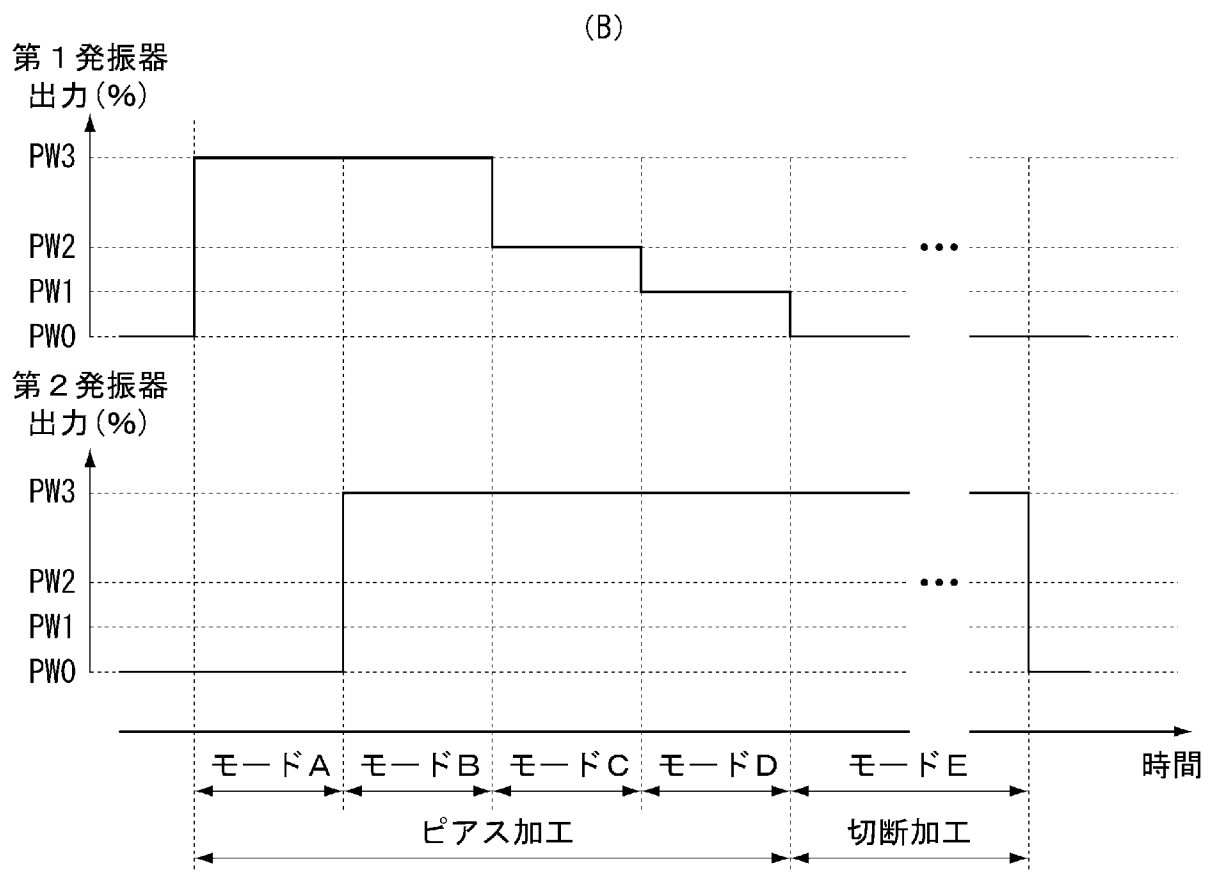
(C)



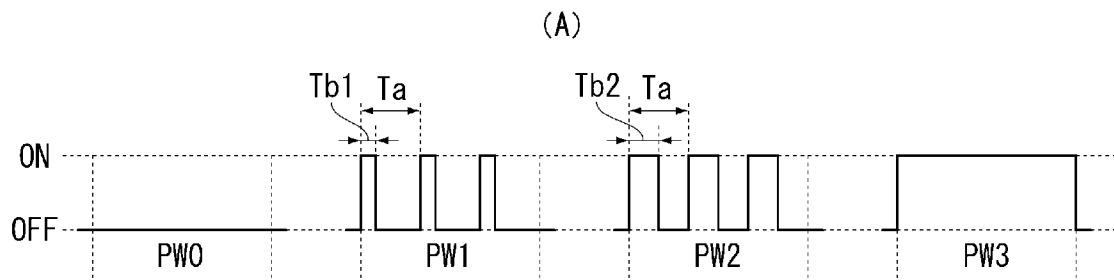
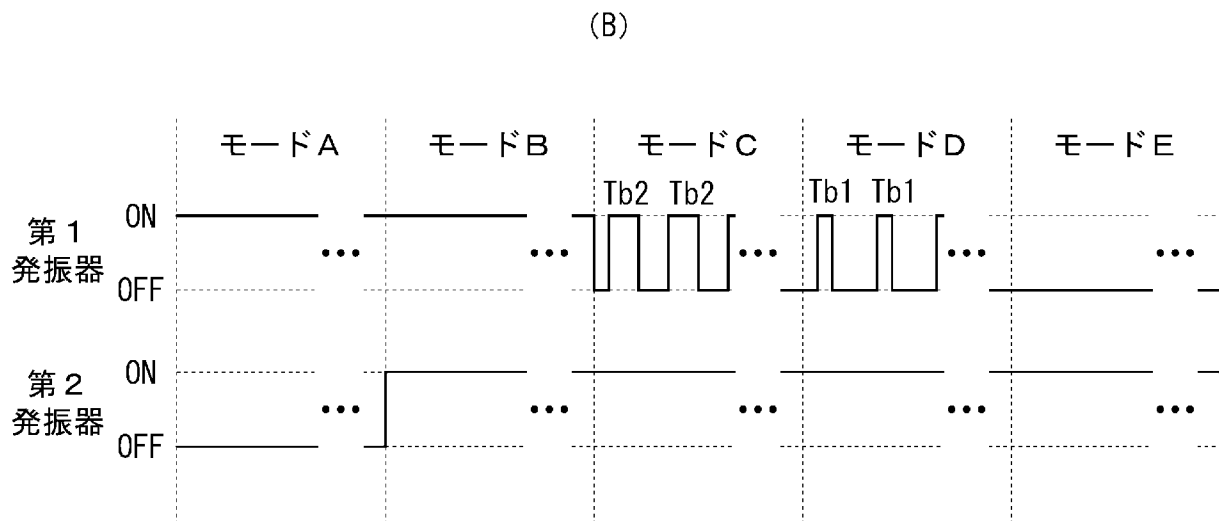
[図3]



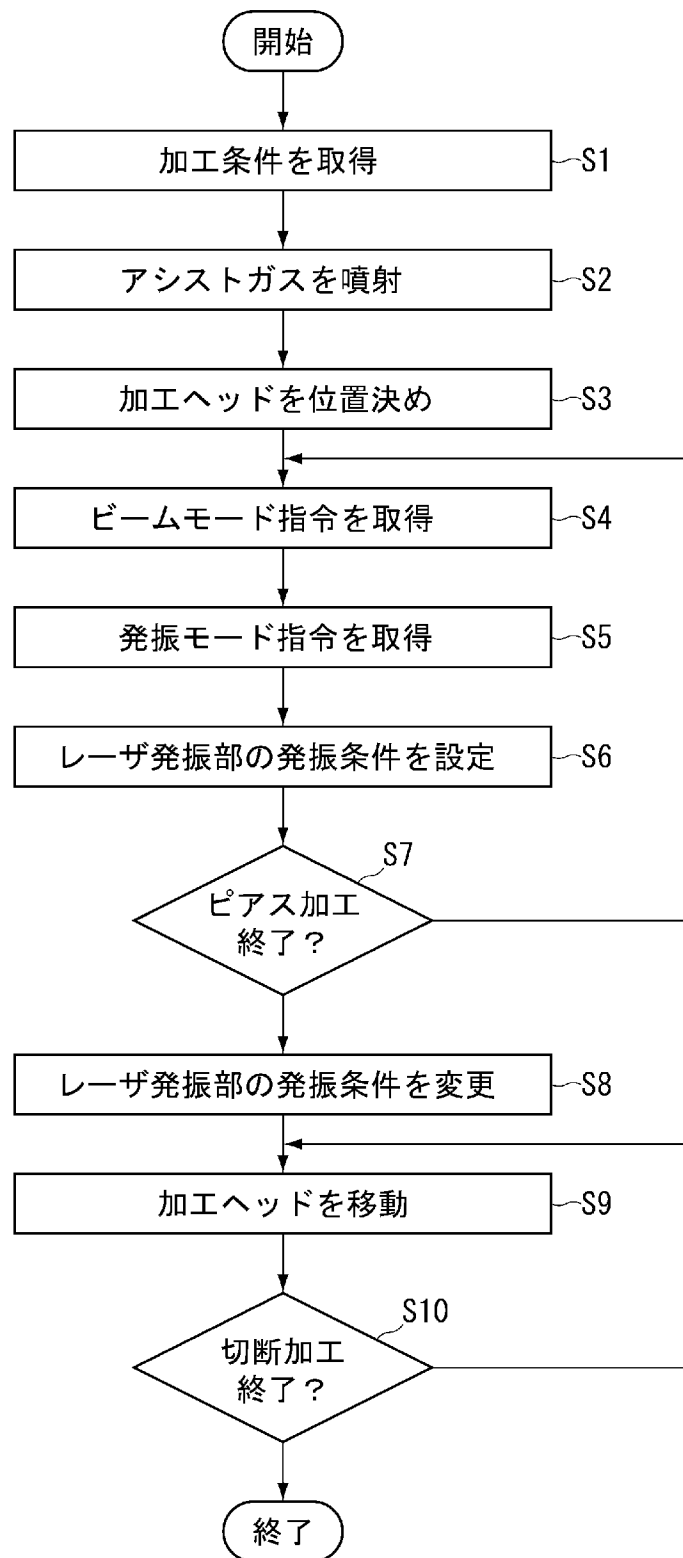
[図4]



[図5]



[図6]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/088688

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

B23K26/382(2014.01)i, B23K26/00(2014.01)i, B23K26/064(2014.01)i,
B23K26/08(2014.01)i, B23K26/38(2014.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

B23K26/382, B23K26/00, B23K26/064, B23K26/08, B23K26/38

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2017
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2017	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2017

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 10-314973 A (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.), 02 December 1998 (02.12.1998), paragraphs [0001], [0029], [0033], [0037]; fig. 5 to 7 (Family: none)	1-3, 6, 9 4-8
Y	JP 6-190576 A (Toshiba Corp.), 12 July 1994 (12.07.1994), paragraphs [0001], [0011] to [0012]; fig. 3 (Family: none)	4-8
Y	JP 8-19888 A (Shibuya Kogyo Co., Ltd.), 23 January 1996 (23.01.1996), paragraphs [0001], [0006]; fig. 1 (Family: none)	5-8

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
06 February 2017 (06.02.17)

Date of mailing of the international search report
14 February 2017 (14.02.17)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/088688

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2013-180295 A (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.), 12 September 2013 (12.09.2013), paragraphs [0020], [0031] to [0032]; fig. 1 to 3 (Family: none)	7

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. B23K26/382(2014.01)i, B23K26/00(2014.01)i, B23K26/064(2014.01)i, B23K26/08(2014.01)i, B23K26/38(2014.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. B23K26/382, B23K26/00, B23K26/064, B23K26/08, B23K26/38

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2017年
日本国実用新案登録公報	1996-2017年
日本国登録実用新案公報	1994-2017年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X Y	JP 10-314973 A (川崎重工業株式会社) 1998.12.02, 段落[0001], [0029], [0033], [0037], 図5-7 (ファミリーなし)	1-3, 6, 9 4-8
Y	JP 6-190576 A (株式会社東芝) 1994.07.12, 段落[0001], [0011]-[0012], 図3 (ファミリーなし)	4-8
Y	JP 8-19888 A (澁谷工業株式会社) 1996.01.23, 段落[0001], [0006], 図1 (ファミリーなし)	5-8

☑ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの	「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)	「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	「&」同一パテントファミリー文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	

国際調査を完了した日

06.02.2017

国際調査報告の発送日

14.02.2017

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

本庄 亮太郎

3 P

6101

電話番号 03-3581-1101 内線 3363

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2013-180295 A (三菱重工業株式会社) 2013. 09. 12, 段落[0020], [0031]-[0032], 図 1-3 (ファミリーなし)	7